

蒸发源及控制器

Evaporators and Controllers

EBE35A、RHE35A、AME35A、RHE100A、TCC100A 等 EBC103、MTC110、MTC210、MTC220、BC206 等



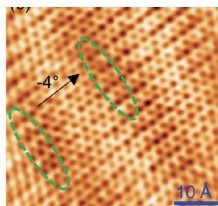
主要技术与性能指标

- 电阻加热蒸发源 - 法兰：DN 40 CF—DN 100 CF；温度范围：100°C—1 500°C；多种坩埚尺寸可选
- 裂解源 - 法兰：DN 40 CF—DN 100 CF；温度范围：低温区 100°C—400°C，高温区 300°C—800°C
- 电子束加热蒸发源 - 法兰：DN40CF；源数量：1；最高工作温度范围： $\geq 3\,000^\circ\text{C}$
- 电子束加热控制器 - 高压源：0—2000 V；250 W；束流检测范围：100 pA—1 mA；灯丝电流：0—7 A
- 多功能温度控制器输出功率：800 W 或 1600 W；输出电流：40 A；控温精度： $\pm 0.1^\circ\text{C}$

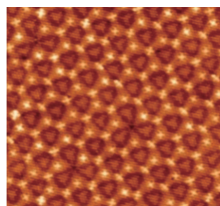
主要应用

MBE，表面科学，薄膜生长，
样品制备，以及 II-VI 族、
III-V 族半导体薄膜研究和太
阳能领域

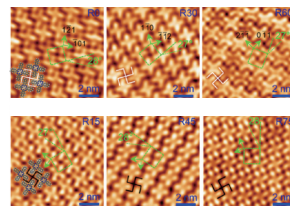
代表性应用成果



固态碳源石墨烯



分子原子自组装



有机分子薄膜制备

主要用户单位	北京大学、复旦大学、南京大学、国家纳米科学中心、中国科学技术大学、中国科学院大学、武汉大学、湖南大学、西安交通大学、中国科学院微电子研究所、美国匹兹堡大学、美国加州大学 Irvine 分校、美国伊利诺伊大学芝加哥分校、IBM 实验室、法国 CEA Saclay、韩国梨花女子大学等
研制单位	中国科学院物理研究所
联系方式	陈小金 010-82648087, 15900692260 cindy.chen@iphy.ac.cn